

## บทที่ 3

### ทฤษฎีพื้นฐาน

เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ได้อิเล็กทริกและค่าแฟกเตอร์ความสูญเสียทางได้อิเล็กทริก ดังนั้นในบทนี้จะได้อธิบายถึงทฤษฎีพื้นฐานทางไฟฟ้า ผลของอุณหภูมิ ความถี่ ขนาดเกรน ความเค้น และ ໂດเมนเฟร์โรอิเล็กทริก ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ได้อิเล็กทริก และค่าแฟกเตอร์ความสูญเสียทางได้อิเล็กทริก รวมไปถึงการวัดค่าสภาพยอนทางไฟฟ้า ซึ่งรายละเอียดในแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้

#### 3.1 ทฤษฎีได้อิเล็กทริก (รัตติกร อัมโนรัตน์, 2536)

สารทุกชนิดประกอบไปด้วยส่วนย่อย คือ อะตอม อะตอมหลาย ๆ อะตอมรวมกันกล้ายเป็นโมเลกุล ซึ่งภายในโมเลกุลนั้นประกอบไปด้วยกลุ่มโปรตอนและกลุ่มอิเล็กตรอนที่มีจุดศูนย์กลางมวลร่วมกันและอยู่ภายใต้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและแรงยึดของอะตอม เมื่อมีแรงจากสนามไฟฟ้ามากระทำกับโมเลกุลจะทำให้กลุ่มประจุบวกถูกดักจับให้อยู่ในทิศทางของสนามและกลุ่มประจุลบจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้นโมเลกุลทุกโมเลกุลของสารจะก่อตัวกันเป็นไดโพลโมเมนต์ (dipole moment) ขนาดเล็กซึ่งไปในทิศทางเดียวกันตามทิศทางของสนามไฟฟ้า สารไดอิเล็กทริกประเภทนี้เรียกว่าสารโมเลกุลมีช้า (non-polar molecule) สารไดอิเล็กทริกบางชนิดที่ไม่สามารถก่อตัวกันเป็นคู่ช้าแต่ทิศทางของไดโพลไฟฟ้า (electric dipole) ซึ่งในทิศทางที่เป็นระเบียบ เมื่อมีแรงจากสนามไฟฟ้าภายนอกมากระทำจะส่งผลให้ไดโพลเรียงตัวกันในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระเบียบซึ่งเรียกโมเลกุลประเภทนี้ว่า โมเลกุlmีช้า (polar molecule) ส่วนสารไดอิเล็กทริกบางชนิดที่ช้าของโมเลกุลนิการจัดเรียงตัวกันได้เองโดยไม่ต้องใช้สนามไฟฟ้าจากภายนอก และไดโพลของโมเลกุลเหล่านี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางได้เมื่อมีการให้สนามไฟฟ้าภายนอกเข้าไปดังนั้นสารชนิดนี้จึงแสดงอำนาจไฟฟ้าด้วยตัวของมันเองเราเรียกสารชนิดนี้ว่า สารเฟร์โรอิเล็กทริก เช่น  $\text{BaTiO}_3$  เป็นต้น

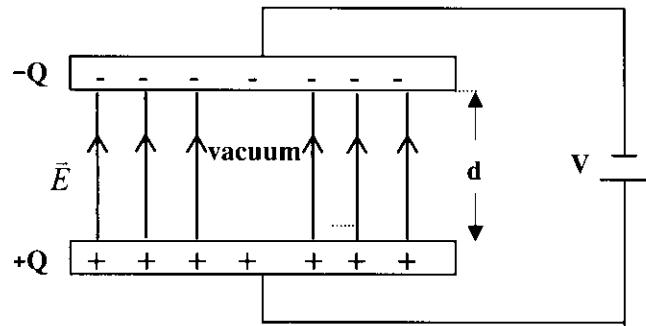
##### 3.1.1 ทฤษฎีไดอิเล็กทริกในระดับมหกรรม (ประสิทธิ์ ทองใบ, 2549)

ไดอิเล็กทริก หรือจนวนไฟฟ้า เป็นวัสดุที่ยอมให้สนามไฟฟ้าผ่านเนื้อสารได้ และเมื่อสารไฟฟ้าผ่านเนื้อสารจะเห็นว่านำไปให้เกิดไดโพลไฟฟ้า (electric dipole) ในวัสดุนั้น การตอบสนองทางไดอิเล็กทริกเป็นผลมาจากการกระจัดในช่วงสั้น ๆ ของประจุภายในไดอิเล็กทริกของสนามไฟฟ้าภายนอกที่ให้เข้าไป โดยการกระจัดของประจุดังกล่าวที่มีผลทำให้เกิดการสะสมของพลังงานไฟฟ้าและเกิดความจุไฟฟ้าในไดอิเล็กทริก โดยที่ความจุไฟฟ้า (capacitance) มีนิยามคือ ความสามารถในการเก็บประจุ ( $Q$ ) ของแผ่นตัวนำสองแผ่นที่อยู่ใกล้กันมาก ๆ เมื่อให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำ  $V$  ดังนั้นจะได้ว่า

$$C = \frac{Q}{V} \quad (3.1)$$

เมื่อพิจารณาระบบตัวเก็บประจุที่ประกอบด้วยแผ่นโลหะตัวนำสองแผ่น โดยแต่ละแผ่นมีพื้นที่  $A$  และแยกออกจากกันเป็นระยะทาง  $d$  ดังภาพที่ 3.1 โดยตัวเก็บประจุแบบแผ่นนานดังกล่าวจะต้องมีระยะห่างระหว่างแผ่น

อิเล็กโตรดันอยามากเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ของแต่ละแผ่น ( $d \ll A$ ) ผลที่ตามมาคือสามารถตัดผลของสนามไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอของบริเวณขอบของแผ่นตัวนำทำห้องส่องได้



ภาพที่ 3.1 ตัวเก็บประจุแบบแผ่นนานะระหว่างแผ่นเป็นสูญญากาศ เมื่อ  $\vec{E}$  และ  $\vec{P}$  คือ สนามไฟฟ้า และ สนามโพลาไรเซชันทางฟ้า ตามลำดับ (ประสิทธิ์ ทองใบ, 2549)

ดังนั้นเราสามารถประมาณได้ว่า สนามไฟฟาระหว่างแผ่นตัวนำมีความสม่ำเสมอ และเมื่อให้ ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นตัวนำ จะได้ว่า

$$E = \frac{V}{d} \quad (3.2)$$

เมื่อ  $E$  คือขนาดของสนามไฟฟ้า และจากกฎของเกาส์ที่กล่าวว่า “ฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าที่ออกจากผิวปิดใด ๆ จะเท่ากับประจุทั้งหมดที่อยู่ในผิวนั้น” เมื่อประยุกต์ใช้กับวัตถุที่สมมาตรแบบระนาบ (plane symmetry) ทำให้สามารถพิสูจน์ได้ว่า สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่นคือ

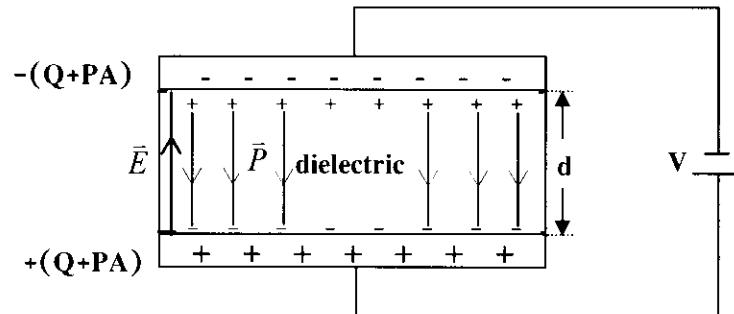
$$E = \frac{\sigma_s}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \quad (3.3)$$

เมื่อ  $\sigma_s$  คือความหนาแน่นประจุอิสระเชิงพื้นผิว,  $Q$  คือประจุอิสระบนแผ่นตัวนำ และ  $\epsilon_0$  คือค่าส่วนย้อมทางไฟฟ้าของสูญญากาศ (permittivity of free space) มีค่าเท่ากับ  $8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$  และจากสมการที่ (3.1), (3.2) และ (3.3) จะได้ว่า

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad (3.4)$$

เมื่อ  $C_0$  คือความจุไฟฟ้าเมื่อระหว่างแผ่นตัวนำเป็นสูญญากาศ

เมื่อวัสดุได้อิเล็กทริก (เช่น พอลิเมอร์ เซรามิก แก้ว ไม้ และอื่นๆ) ถูกบรรจุในตัวเก็บประจุแบบแผ่นนาน สนามไฟฟ้าจะเหนี่ยวนำให้ประจุที่อยู่ภายในวัสดุได้อิเล็กทริกแยกออกจากกัน โดยประจุบวกเคลื่อนที่ไปทางด้านขับลบทองอิเล็กโทรดและประจุลบเคลื่อนที่ไปทางด้านขับบวกของอิเล็กโทรด ดังแสดงในภาพที่ 3.2 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเรียกว่า “โพลาไรเซชันทางฟ้า (electric polarization,  $\bar{P}$ )”



ภาพที่ 3.2 ตัวเก็บประจุแบบแผ่นนานระหว่างแผ่นเป็นสารได้อิเล็กทริก เมื่อ  $\vec{E}$  และ  $\vec{P}$  คือ สนามไฟฟ้าและสนามโพลาไรเซชันทางฟ้า ตามลำดับ (ประสิทธิ์ ทองใบ, 2549)

สำหรับวัสดุใดๆ โพลาไรเซชันมีนิยามคือ ปริมาณเวกเตอร์ที่แสดงพื้นที่และทิศทางของไดโอลูเมนต์ไฟฟ้า (dipole moment) สูงสุดของตัวกลางต่อหน่วยปริมาตร การเกิดโพลาไรเซชันมีผลทำให้แผ่นคุณนาที่มีวัสดุได้อิเล็กทริกอยู่ระหว่างแผ่นมีความสามารถในการเก็บประจุมากขึ้น ที่ความต่างศักย์เท่าเดิม อัตราส่วนระหว่างความจุไฟฟ้าของวัสดุได้อิเล็กทริกกับความจุไฟฟ้าของสัญญาณเรียกว่า “สภากยอมทางไฟฟ้าสัมพath (relative permittivity,  $\epsilon_r$ )” หรือเรียกว่า “ค่าคงที่ได้อิเล็กทริก (dielectric constant,  $k$ )” สามารถเขียนได้เป็น

$$\epsilon_r = k = \frac{C}{C_0} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad (3.5)$$

เมื่อ  $\epsilon$  คือ ค่าสภากยอมทางไฟฟ้าของได้อิเล็กทริก (permittivity of dielectric) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ค่าคงที่ได้อิเล็กทริก คือ อัตราส่วนระหว่างค่าสภากยอมทางไฟฟ้าของได้อิเล็กทริกกับค่าสภากยอมทางไฟฟ้าของสัญญาณ ดังนั้นจากสมการที่ (3.5) จะได้ว่า

$$\epsilon_r = \frac{Q + PA}{Q} = \frac{Q/A + P}{Q/A} \quad (3.6)$$

จากสมการที่ (3.3) และ (3.6) สามารถจัดเป็นสมการในรูปของเวกเตอร์ได้คือ

$$\bar{P} = (\epsilon_r - 1)\epsilon_0 \bar{E} = \chi_e \epsilon_0 \bar{E} \quad (3.7)$$

เมื่อ  $\bar{E}$  คือสนามไฟฟ้าสุทธิ และ  $\chi_e = (\epsilon_r - 1)$  เป็นค่าคงที่ เรียกว่า “ส่วนรับไว้ได้ทางไฟฟ้า (electric susceptibility)” ของตัวกลาง เป็นค่าที่บ่งบอกสมบัติความไวของการตอบสนองทางไดอิเล็กทริกเนื่องจากสนามไฟฟ้า วัสดุที่เป็นไปตามสมการที่ (3.7) เรียกว่า ไดอิเล็กทริกเชิงเส้น (linear dielectric) เมื่อจัดสมการที่ (3.7) ใหม่ “การกระจัดทางไฟฟ้า (electric displacement,  $\bar{D}$ )” มีนิยามเป็น

$$\bar{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \bar{E} = \epsilon_0 \bar{E} + \bar{P} \quad (3.8)$$

$$\epsilon_r = 1 + \frac{P}{\epsilon_0 E} \quad (3.9)$$

จากสมการที่ (3.8) สามารถสรุปได้ว่า โพลาไรเซชันในวัสดุไดอิเล็กทริกมีผลกระทำต่อสนามไฟฟ้า คือทำให้ความหนาแน่นของฟลักซ์ไฟฟ้า  $\bar{D}$  มีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ  $\bar{P}$  หรือถ้าได้ว่า เมื่อมี  $\bar{E}$  มากระทำกับวัสดุไดอิเล็กทริก ความหนาแน่นของฟลักซ์ไฟฟ้าจะมีค่ามากกว่าขณะอยู่ในสัญญาณ (ก่อนเกิดโพลาไรเซชัน) เท่ากับ  $\bar{P}$  และจากสมการที่ (3.9) ซึ่งเป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับการโพลาไรเซชัน หมายความว่าค่าคงที่ไดอิเล็กทริกเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการโพลาไรเซชัน แต่เมื่อพิจารณากรณีในสัญญาณ ( $\bar{P} = 0$ ) และ  $\bar{D}$  ขึ้นอยู่กับสนามภายนอกเท่านั้น ถ้าให้สนามไฟฟ้าภายนอกเป็น  $\bar{E}_0$  การกระจัดทางไฟฟ้าจะมีนิยามเป็น (รัตติกร ยิ่มนิรัณ, 2536)

$$\bar{D} = \epsilon_0 \bar{E}_0 \quad (3.10)$$

ทฤษฎีเกี่ยวกับไดอิเล็กทริกทั้งหมดที่ได้พิจารณามาจนนี้เป็นทฤษฎีของไดอิเล็กทริกในอุดมคติ (ideal dielectric) ในความเป็นจริงไม่มีวัสดุใดเป็นไดอิเล็กทริกในอุดมคติ เมื่อสนามไฟฟ้าในไดอิเล็กทริกมีค่าสูงมากพอสนามไฟฟ้านี้จะเริ่มดึงอิเล็กตรอนออกจากโมเลกุลทำให้ไดอิเล็กทริกแปรสภาพเป็นตัวน้ำ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “การพังทลายของไดอิเล็กทริก (dielectric breakdown)” ซึ่งเกิดขึ้นในไดอิเล็กทริกทุกชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุ อุณหภูมิ ความชื้น และเวลาที่สนามไฟฟ้ากระทำต่อไดอิเล็กทริก ค่าสุดของสนามไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการพังทลายของไดอิเล็กทริก เรียกว่า “ความคงทนของไดอิเล็กทริก (dielectric strength)” ของวัสดุไดอิเล็กทริก

### 3.1.2 ทฤษฎีไดอิเล็กทริกในระดับจุลทรรศน์ (Kao, 2004) และ (รัตติกร ยิ่มนิรัณ, 2536)

เมื่อพิจารณาการโพลาไรเซชันในระดับโมเลกุล ปริมาณทางกายภาพของโมเลกุลที่เรียกว่า สภาพมีข้าวได้ (polarizability,  $\alpha$ ) ของโมเลกุลต้องนำมาพิจารณาด้วย โดยปริมาณดังกล่าวนี้เป็นปริมาณสเกลาร์ และมีนิยามคือ ไดโอลิเมนต์เฉลี่ยของโมเลกุล (average molecular dipole moment,  $\bar{\mu}$ ) ที่เกิดภายใต้แรงกระทำของสนามไฟฟ้าภายนอกต่อหน่วยความแรงของสนามท้องถิ่น (local electric field,  $\bar{E}_L$ ) สำหรับวัสดุไดอิเล็กทริกใดๆ สามารถสมมติได้ว่าไดโอลิเมนต์เฉลี่ยที่เกิดขึ้นในเนื้อสารมีทิศทางขานกับสนามไฟฟ้าภายนอกไดอิเล็กทริก ดังนั้นสมการของค่าสภาพมีข้าวได้ของโมเลกุลสามารถกำหนดเป็นปริมาณสเกลาร์ได้โดยมีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

$$\bar{\mu} = \alpha E_L \quad (3.11)$$

เมื่อกำหนดให้  $N$  คือจำนวนของอะตอม (หรือโมเลกุล) ต่อหน่วยปริมาตร ดังนั้นภัยหลังจากการให้สนามไฟฟ้า ( $\bar{E}$ ) ผลรวมของไดโพลโมเมนต์ต่อหน่วยปริมาตรหรือโพลาไรเซชัน ( $\bar{P}$ ) คือ

$$\bar{P} = N\bar{\mu} \quad (3.12)$$

แทนค่า  $\bar{\mu}$  จากสมการที่ (3.11) ในสมการที่ (3.12) จะได้ว่า

$$\bar{P} = N\alpha\bar{E}_L \quad (3.13)$$

จากสมการที่ (3.13) และ (3.7) จะได้ว่า

$$(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0\bar{E} = N\alpha\bar{E}_L \quad (3.14)$$

จากสมการที่ (3.14) พบว่าเป็นสมการที่เชื่อมโยงกันระหว่างค่า  $\varepsilon_r$  และ  $\bar{E}$  ซึ่งเป็นปริมาณที่สามารถ量ได้ในระดับมหกรรมกับตัวแปรที่เกิดจากการพิจารณาในระดับโมเลกุล คือ  $N$ ,  $\alpha$  และ  $\bar{E}_L$

เนื่องจากว่า  $\bar{E}_L$  และ  $\bar{E}$  เป็นปริมาณที่แตกต่างกัน โดยที่  $\bar{E}_L$  หมายถึงสนามไฟฟ้าภายในไดอิเล็กทริกที่ออกแรงกระทำกับโมเลกุลของไดอิเล็กทริก หรือที่เรียกว่าสนามห้องถีน (local field,  $\bar{E}_L$ ) ในส่วนของ  $\bar{E}$  หมายถึงสนามไฟฟ้าสุทธิที่กระทำกับชั้นของวัสดุไดอิเล็กทริก ความแตกต่างระหว่าง  $\bar{E}_L$  กับ  $\bar{E}$  ขึ้นกับอันตรกิริยาภัยในโมเลกุลของไดอิเล็กทริกหลังจากการโพลาไรเซชัน ถ้าอันตรกิริยามีขนาดอ่อนๆ เช่นในการณ์ของไดอิเล็กทริกจำพวกก้าช  $\bar{E}_L$  สามารถกำหนดให้เท่ากับ  $\bar{E}$  ได้ แต่สำหรับเซรามิกซึ่งเป็นวัสดุที่มีระยะห่างภัยโมเลกุลมาก มีอยู่มาก ดังนั้นอันตรกิริยาของไดโพลไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำขึ้นในแต่ละโมเลกุลจะมีผลที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นแล้วในกรณีนี้  $\bar{E}_L$  และ  $\bar{E}$  จะมีค่าที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก

ในการหา  $\bar{E}_L$  ต้องคำนวณสนามรวมที่กระทำบนขั้วคู่ทั้งหมดซึ่งสนามทั้งหมดนี้ประกอบด้วยสนามจากภายนอกและสนามจากทุกขั้วในระบบ ดังนั้น

$$\bar{E}_L = \bar{E}_0 + \bar{E}_1 + \bar{E}_2 + \bar{E}_3 \quad (3.15)$$

เมื่อ

$\bar{E}_0$  คือ สนามภายนอก

$\bar{E}_1$  คือ สนามผลการเป็นขั้วเนื่องจากความหนาแน่นประจุที่ผิวของเนื้อสาร

$\bar{E}_2$  คือ สนามเนื่องจากประจุโพลาไรเซชันที่อยู่บนผิวทรงกลมของโลเรนซ์ (Lorentz Cavity)

$\bar{E}_3$  คือ สนามเนื่องจากไดโพลอื่นๆ ภายนอกในทรงกลมกลวง

ซึ่งแยกพิจารณาสนามดังๆ ตามลำดับดังนี้

สนาม  $\bar{E}_1$  เป็นสนามลดการเป็นข้าว (depolarization field) เกิดจากประจุโพลาไรเซชันที่อยู่บนผิวภายนอกของสารไดอิเล็กทริก ค่าของสนามนี้ขึ้นกับรูปทรงเรขาคณิตของพื้นผิวภายนอก สำหรับกรณีสารไดอิเล็กทริกที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง (infinite slab) จะได้

$$\bar{E}_1 = -\left(\frac{1}{\epsilon_0}\right)\bar{P} \quad (3.16)$$

สนาม  $\bar{E}_2$  เป็นสนามที่เกิดจากประจุโพลาไรเซชันที่อยู่บนผิวทรงกลมของโลเรนซ์ (Lorentz Cavity) ซึ่งจะได้สนามไฟฟ้าที่จุดศูนย์กลางบนทรงกลมรัศมี  $R$  เป็น

$$\begin{aligned} \bar{E}_2 &= \int_0^\pi \left( \frac{-\bar{P} \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \right) \cos \theta (2\pi R^2 \sin \theta d\theta) \\ \bar{E}_2 &= \frac{1}{3\epsilon_0} \bar{P} \end{aligned} \quad (3.17)$$

สนาม  $\bar{E}_3$  เป็นสนามเนื่องจากไดโพล (dipoles) อื่นๆภายในทรงกลมกลวงหาโดยการรวมสนามของไดโพลห้องหมุดจาก

$$\bar{E}_3 = \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \left[ \frac{3(\bar{p} \cdot \bar{r})\bar{r} - r^2 \bar{p}}{r^5} \right]$$

เมื่อ  $\bar{P} = N\bar{p}$  โดยที่  $\bar{p}$  คือ ไดโพลโน้มเนตของโมเลกุล ซึ่งค่า  $\bar{E}_3$  จะขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของผลึก ในการณ์ที่พิจารณาโครงสร้างเป็นลูกบาศก์ จะได้

$$\bar{E}_3 = 0 \quad (3.18)$$

แทนค่าสมการที่ (3.16),(3.17) และ (3.18) ในสมการที่ (3.15) จะได้ว่า

$$\bar{E}_L = \bar{E}_0 - \frac{2}{3\epsilon_0} \bar{P} \quad (3.19)$$

ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้าท้องถิ่นภายในไดอิเล็กทริกกับสนามภายนอกและโพลาไรเซชันเมื่อพิจารณาจากสมการที่ (3.8) และ (3.10) จะได้ว่า

$$\bar{E} = \bar{E}_0 - \frac{1}{\epsilon_0} \bar{P} \quad (3.20)$$

แทนค่าสมการที่ (3.20) ในสมการที่ (3.19) จะได้ว่า

$$\bar{E}_L = \bar{E} + \frac{1}{3\epsilon_0} \bar{P} \quad (3.21)$$

เรียกสมการที่ (3.20) ว่า Lorentz relation ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าสนาม  $\bar{E}_L$  มีค่ามากกว่าสนาม  $\bar{E}$

ถ้าพิจารณาค่า  $\alpha$  จะพบว่าเป็นสมบัติของแต่ละอะตอมหรือโมเลกุล แต่ค่าคงที่ได้อิเล็กทริก จะขึ้นอยู่กับลักษณะที่อะตอมหรือโมเลกุลที่รวมกันเป็นผลลัพธ์ ดังนั้นโพลาไรเซชันของผลลัพธ์จะมีค่าเป็น ·

$$\bar{P} = \sum N_j \alpha_j \bar{E}_{L(j)} \quad (3.22)$$

เมื่อ

$N_j$  คือ จำนวนอะตอมที่  $j$  ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร

$\alpha_j$  คือ ค่าสภานมีข้อได้ของอะตอมที่  $j$

$\bar{E}_{L(j)}$  คือ สนามไฟฟ้าภายในได้อิเล็กทริก ณ ตำแหน่งอะตอมที่  $j$

แทนค่าสมการที่ (3.21) ในสมการที่ (3.22) จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \bar{P} &= \sum N_j \alpha_j \left[ \bar{E} + \frac{1}{3\epsilon_0} \bar{P} \right] \\ \bar{P} &= \frac{\sum N_j \alpha_j \bar{E}}{\left( 1 - \frac{\sum N_j \alpha_j}{3\epsilon_0} \right)} \end{aligned} \quad (3.23)$$

จากสมการที่ (3.7) และจาก  $\chi_e = (\epsilon_r - 1)$  จะได้ว่า

$$\epsilon_r = \frac{\left( 1 + \frac{2}{3\epsilon_0} \sum N_j \alpha_j \right)}{\left( 1 - \frac{1}{3\epsilon_0} \sum N_j \alpha_j \right)} \quad (3.24)$$

จัดรูปสมการที่ (3.24) จะได้

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = \frac{\sum N_j \alpha_j}{3\epsilon_0} \quad (3.25)$$

จากสมการที่ (3.24) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของค่าคงที่ไดอีเล็กทริก (dielectric constant) กับค่า สภาพมีข้าวได (polarizability) ซึ่งเรียกว่า Clausius–Mosotti relation

### 3.1.3 การโพลาไรเซชันทางไฟฟ้า (ประสิทธิ์ ทองใบ, 2549)

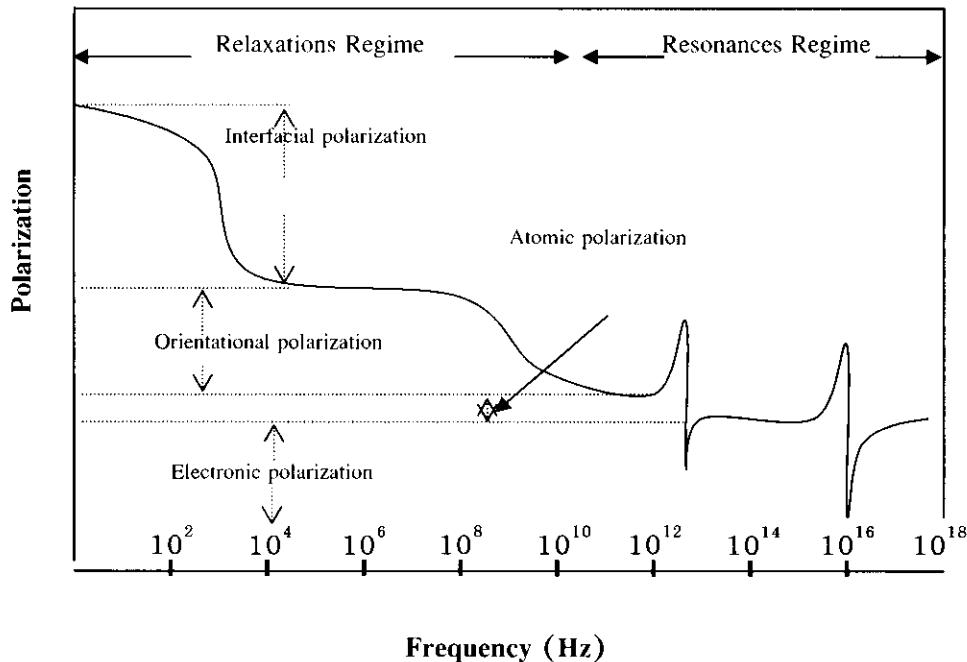
เมื่อกล่าวถึงกระบวนการเกิดโพลาไรเซชันทางไฟฟ้า กลไกของการเกิดสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

3.1.3.1 *Electronic polarization* ( $\vec{P}_e$ ) เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้า ภายนอกมีผลทำให้เกิดการกระจัดระหว่างจุดศูนย์กลางของกลุ่มหมอกอีเล็กตรอน (electron cloud) กับนิวเคลียสของอะตอม กลไกโพลาไรเซชันดังกล่าวสามารถเกิดได้ที่ความถี่สูงสุดประมาณ  $10^{15}$  Hz หรือในช่วงคลื่นความถี่ของแสงอัลตราไวโอเลต (UV) โดยดันหักเหของแสงในวัสดุจะขึ้นกับ  $\vec{P}_e$  และมีผลทำให้เกิดพีคของการดูดกลืน (resonance absorption peak) ดังแสดงในภาพที่ 3.3

3.1.3.2 *Atomic polarization* ( $\vec{P}_a$ ) เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าภายนอก มีผลทำให้เกิดการกระจัดระหว่างอะตอมที่เป็นไอออนบากับอิกอะตอมที่เป็นไอออนลบ กลไกของการเกิดโพลาไรเซชันดังกล่าวสามารถเกิดได้ที่ความถี่สูงสุดประมาณ  $10^{12} - 10^{13}$  Hz หรือในช่วงคลื่นความถี่ของรังสีอินฟราเรดและพีคของการดูดกลืนจะเกิดที่ความถี่เฉพาะ (ขึ้นกับความแข็งแรงของพันธะระหว่างไอออน)

3.1.3.3 *Orientational polarization* ( $\vec{P}_d$ ) หรือที่เรียกว่า Dipolar polarization เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าภายนอกมีผลทำให้ไดโอลไฟฟ้าถ่ายรายในโนมเลกูลเกิดการหมุนและจัดเรียงตัวในทิศทางของสนามไฟฟ้าภายนอก การโพลาไรเซชันนี้เป็นกลไกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมทางไดอีเล็กทริกของแก้วและเซรามิก โดยเกิดในช่วงความถี่  $10^3 - 10^6$  เฮิร์ซ (ที่อุณหภูมิห้อง) ในกรณีที่เกิดจากการหมุนของไดโอลไฟฟ้าจะเกิดขึ้นในวัสดุประเทเฟโรอีเล็กทริก โดยจะแสดงการโพลาไรเซชันอย่างถาวรแม้ว่าจะไม่มีสนามไฟฟ้าเข้าเกี่ยวข้อง เป็นการ “โพลาไรเซชันแบบไม่เป็นเชิงเส้น (nonlinear polarization)” ทำให้ค่าคงที่ไดอีเล็กทริกมีค่าสูงถึง  $10^4$  แต่สำหรับในกรณีโพลาไรเซชันเชิงเส้น จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของประจุที่เป็นไอออนในช่วงสั้น ๆ ภายในโครงสร้างของสารประกอบไฮอนิกของจวนไฟฟ้า

3.1.3.4 *Interfacial polarization* หรือ space charge polarization ( $\vec{P}_i$ ) เกิดขึ้นในวัสดุไดอีเล็กทริกที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (heterogeneous dielectric) โดยเกิดขึ้นที่ความถี่ต่ำ (น้อยกว่า  $10^3$  Hz) และที่อุณหภูมิสูง การโพลาไรเซชันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการสะสมของประจุพำนัที่เคลื่อนที่ได (mobile charge carriers) (โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นไอออน) ณ บริเวณผิวรอยต่อระหว่างเฟสที่มีสภาพนำไฟฟ้าสูงกับเฟสที่เป็นจวน (สภาพนำไฟฟ้าต่ำ) ภายในไดอีเล็กทริก ประจุที่สะสมดังกล่าวมีผลทำให้เกิดสนามภายในไฟฟ้าในและมีผลทำให้ความจุไฟฟ้าและค่าคงที่ไดอีเล็กทริกมีค่าเพิ่มขึ้น ถ้าพูดต่อรูปดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่อิเล็กโทรด จะเรียกว่า อิเล็กโทรดโพลาไรเซชัน (electrode polarization) ทำให้ความจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากระยะห่างของประจุบวกและลบมีค่าที่น้อยมาก ซึ่งอาจจะอยู่ในระดับอะตอม (ค่าความจุไฟฟ้าจะแปรผูกพันกับระยะที่แยกกันระหว่างประจุ ถ้าความหนาแน่นของประจุที่ทำให้เกิดโพลาไรเซชันมีค่ามาก การตอบสนองต่อการโพลาไรเซชันดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงความถี่ที่เพิ่มขึ้นถึง  $1 \text{ kHz}$  ในกรณีนี้จะไม่สามารถจำแนกการตอบสนองต่อความถี่ระหว่าง Dipolar polarization และ Interfacial polarization ได้



ภาพที่ 3.3 แผนภาพแสดงการเกิดโพลาไรเซชันที่ความถี่ต่างๆ (ประสิทธิ์ ทองใบ, 2549)

### 3.1.4 ผลของอุณหภูมิต่อค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าแฟกเตอร์ความสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (รัตติกร ยิ่มนิรัณ, 2536)

ในการอธิบายผลของอุณหภูมิต่อค่าคงที่ไดอิเล็กทริกนั้นสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนในกรณีเฉพาะที่อยู่ในย่านที่สารไดอิเล็กทริกมีสภาวะเป็นพาราอิเล็กทริกเท่านั้นโดยใช้ทฤษฎีของ Catastrophe อย่างง่ายโดยสมมติว่าสถานภาพภายในไดอิเล็กทริกมีต่อตั้งสมการ (3.21) คือ

$$\bar{E}_t = \bar{E} + \frac{1}{3\epsilon_0} \bar{P}$$

จากสมการที่ (3.8) และ  $\chi_e = (\epsilon_r - 1)$  และ สมการที่ (3.7) โดยที่  $\chi_e = \frac{\bar{P}}{\epsilon_0 \bar{E}}$  จะได้

$$\epsilon_r = 1 + \frac{\bar{P}}{\epsilon_0 \bar{E}} \quad (3.26)$$

และจากสมการที่ (3.23) คือ

$$\varepsilon_r = \frac{\left(1 + \frac{2}{3\varepsilon_0} \sum N_j \alpha_j\right)}{\left(1 - \frac{1}{3\varepsilon_0} \sum N_j \alpha_j\right)}$$

จากสมการที่ (3.23) จะเห็นได้ว่าค่าคงที่ไดอิเล็กทริก  $\varepsilon_r$  จะมีค่าเป็นอนันต์เมื่อ

$$\sum N_j \alpha_j = 3\varepsilon_0 \quad (3.27)$$

แต่ในความเป็นจริงแล้ว  $\varepsilon_r$  ในไม่ได้มีค่าเป็นอนันต์เพียงแต่มีค่าสูงมากจึงกำหนดให้

$$\frac{1}{3\varepsilon_0} \sum N_j \alpha_j = 1 - \Delta \quad (3.28)$$

โดยถ้า  $\Delta \ll 1$  ทำให้ได้ว่า

$$\varepsilon_r \approx \frac{3}{\Delta} \quad (3.29)$$

ถ้าพิจารณาเฉพาะบริเวณใกล้ๆ อุณหภูมิวิกฤต  $T_c$  หรือเรียกว่า อุณหภูมิคูรี (Curie temperature) นั้นจะได้ว่า  $\Delta$  ขึ้นกับอุณหภูมิตั้งสมการ

$$\Delta \approx \frac{3(T - T_c)}{C} \quad (3.30)$$

ทำให้ได้ว่า

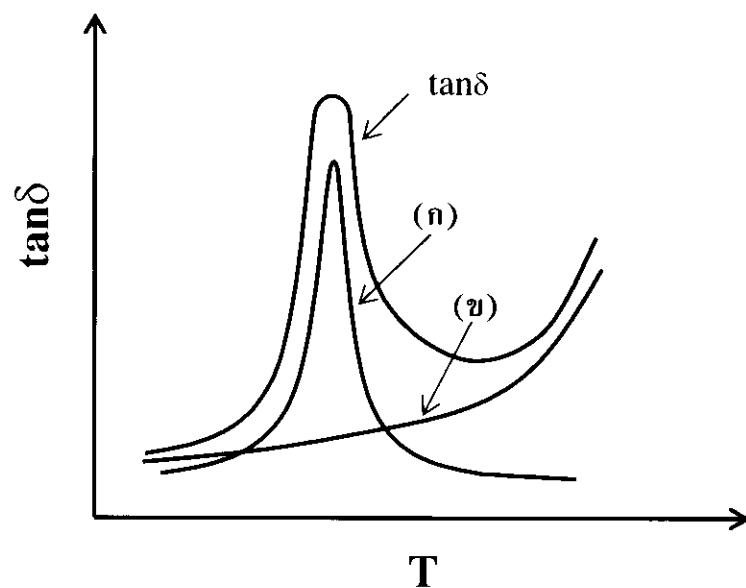
$$\varepsilon_r = \frac{C}{T - T_c} \quad (3.31)$$

เมื่อ  $C$  เป็นค่าคงที่คูรี (Curie constant) จากสมการที่ (3.31) เรียกว่า Curie-Weiss law ซึ่งใช้อธิบายผลของ อุณหภูมิต่อค่าคงที่ไดอิเล็กทริกในสมภาวะพาราอิเล็กตริก

เมื่อพิจารณาถึงผลของอุณหภูมิต่อค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ( $\tan\delta$ ) โดยทั่วไปแล้วค่า การสูญเสียทางไดอิเล็กทริกควรจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก นั้นเกิดมาจากการเพิ่มขึ้นของการร้าวของกระแส ( $I_R$ ) นั่นก็คือการลดลงของค่าความต้านทานของไดอิเล็กทริกด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้วการสูญเสียในสารไดอิเล็กทริกไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่ากระแสร้าวเพียงอย่างเดียว แต่มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคือ

- การสูญเสียเนื่องจากความต้านทานไม่ถึงอนันต์
- การสูญเสียเนื่องจากการผ่อนคลายไดโพล (dipole relaxation)
- การสูญเสียเนื่องจากการโพลาไรเซชันของอิเล็กตรอน (electron polarization)
- การสูญเสียเนื่องจากการสั่นของไอออน

ช่องการสูญเสียเนื่องจากความต้านทานไม่ถึงอนันต์และการสูญเสียเนื่องจากการผ่อนคลายไดโพล เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางไดอิเล็กทริกในช่วงความถี่ต่างๆ ส่วน การสูญเสียเนื่องจากการโพลาไรเซชันของอิเล็กตรอน และ การสูญเสียเนื่องจากการสั่นของไอออน จะเกิดขึ้นในย่านความถี่สูง ๆ เท่านั้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ( $\tan\delta$ ) เมื่อเทียบกับอุณหภูมิจะชี้อยู่กับประเภทของสารไดอิเล็กทริกในสารไดอิเล็กทริกประกายมีข้า (polar) นั้นจะมีค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกเนื่องจากเกิดการผ่อนคลายไดโพล และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกเนื่องจากการนำไฟฟ้า ซึ่งจะมีค่ามากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แสดงดังภาพที่ 3.4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดจากการผ่อนคลายไดโพลและผลที่เกิดจากการนำไฟฟ้า



ภาพที่ 3.4 แผนภาพแสดงผลของอุณหภูมิต่อค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ( $\tan\delta$ ) ของสารไดอิเล็กทริกประกายมีข้า (g) ค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกเนื่องจากการนำไฟฟ้า (รัตติกร อิมมนิรัญ, 2536)

### 3.1.5 ผลของความถี่ต่อค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าแฟกเตอร์ความสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริก (รัตติกร ยิ่มนิรัณ, 2536)

เมื่อใส่สานามไฟฟ้า ความเรื่อยของการโพลาไรซ์ จะทำให้เกิด การผ่อนคลาย (relaxation) ขึ้น ซึ่ง กระบวนการผ่อนคลายนั้นจะขึ้นอยู่กับความถี่ของสานามไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปและกระบวนการผ่อนคลายนั้นสามารถ อธิบายได้โดยสมการของเดอบาย (Debye equation) เมื่อพิจารณากระบวนการผ่อนคลายโพลาไรเซชัน (polarization relaxation) โดยเทียบกับความถี่ ถ้าค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสถิติ (static dielectric constant,  $\epsilon_s$ ) และ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกเชิงแสง (optical dielectric constant,  $\epsilon_\infty$ ) เป็นค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ (relative dielectric constant) เมื่อสานามไฟฟ้ามีความถี่ต่ำกว่าและสูงกว่าความถี่ธรรมชาติของการโพลาไรซ์มาก ๆ ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก อาจอธิบายได้ในรูปของ

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_\infty + f(\omega) \quad (3.32)$$

เมื่อ  $\omega$  มีค่าเข้าใกล้ 0 จะได้ว่า

$$f(0) = \epsilon_s - \epsilon_\infty \quad (3.33)$$

ถ้าสมมติว่าให้สานามไฟฟ้าสำเนอในสารไดอิเล็กทริก แล้วนำสานามไฟฟ้านั้นออกหันที่ การโพลาไรซ์ในสารไดอิเล็กทริกจะลดลงแบบเอกซ์เพแนลเชียล (exponential) ด้วยค่าคงที่เวลาการผ่อนคลาย  $\tau$  ของโมเลกุล

$$P(t) = P_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (3.34)$$

ถ้า  $f(\omega)$  เป็นสเปกตรัมของความถี่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลาของการโพลาไรเซชัน ดังนั้นจาก การแปลงฟูเรียร์ (Fourier transform) จะได้ว่า

$$f(\omega) = \int_0^\infty P(t) e^{j\omega t} dt$$

$$f(\omega) = \frac{P_0}{-i\omega + \frac{1}{\tau}} \quad (3.35)$$

ดังนั้นที่  $\omega = 0$  จะได้ว่า

$$f(0) = \tau P_0 \quad (3.36)$$

และเมื่อพิจารณาสมการที่ (3.33) และ สมการที่ (3.35) จะได้ความสัมพันธ์

$$f(\omega) = \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{1 - j\omega t} \quad (3.37)$$

ดังนั้นจากสมการที่ (3.32) จะได้

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{1 - j\omega t} \quad (3.38)$$

และในสนาમไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมีการสูญเสียเกิดขึ้นสามารถเขียน  $\varepsilon(\omega)$  ในรูปของจำนวนเชิงช้อนได้เป็น

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon' - j\varepsilon'' \quad (3.39)$$

เมื่อพิจารณาสมการที่ (3.38) และสมการที่ (3.39) จะได้ว่า

$$\varepsilon' = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{1 + \omega^2 \tau^2} \quad (3.40)$$

$$\varepsilon'' = \frac{(\varepsilon_s - \varepsilon_\infty)\omega\tau}{1 + \omega^2 \tau^2} \quad (3.41)$$

$$\tan \delta = \frac{\varepsilon'}{\varepsilon''} \quad (3.42)$$

$$\tan \delta = \frac{(\varepsilon_s - \varepsilon_\infty)\omega\tau}{\varepsilon_s + \varepsilon_\infty \omega^2 \tau^2} \quad (3.43)$$

โดยที่สมการที่ (3.40)-(3.43) คือสมการของเดอบาย (Debye equation) โดยที่เทอมของ  $\varepsilon'$  เกี่ยวข้องกับค่าคงที่ไดอิเล็กทริก และ เทอมของ  $\tan \delta$  เกี่ยวข้องกับค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก

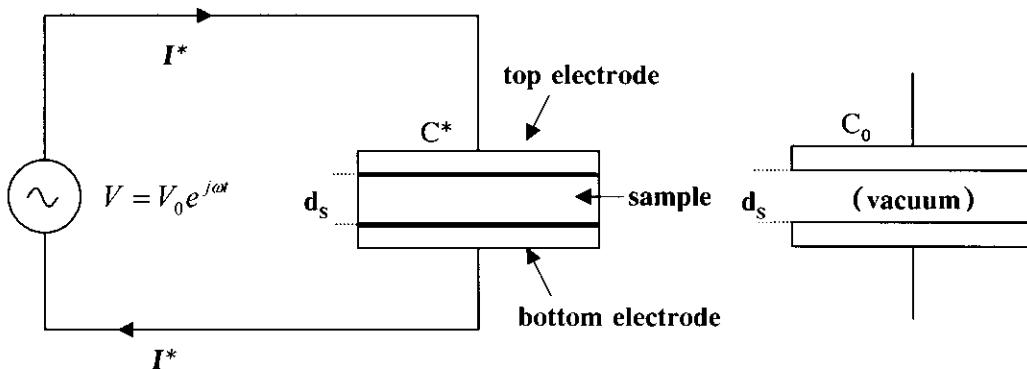
### 3.1.6 การวัดค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ประสิทธิ์ ทองใบ, 2549)

สำหรับการทดลองวัดค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าหรือค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุไดอิเล็กทริก โดยใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสสลับและความต่างศักย์ที่ให้กำหนดโดยส่วนจริงของ  $V = V_0 e^{j\omega t}$  (เมื่อ  $V_0$  คือแอมป์ลิจูด,  $\omega$  คือความถี่เชิงมุม และ  $t$  คือเวลา) เมื่อให้ความต่างศักย์ตกคร่อมสารตัวอย่างซึ่งวางอยู่ระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสองข้าง ดังภาพที่ 3.5 กระแสที่วัดได้คือส่วนจริงของกระแสไฟฟ้าเชิงช้อน ( $I^* = I_0 e^{j\omega t}$ ) ซึ่งถูกกำหนดโดย

$$I^* = C^* \frac{dV}{dt} = \varepsilon(\omega) C_0 \frac{dV}{dt} = j\omega \varepsilon(\omega) C_0 V \quad (3.44)$$

เมื่อ  $C^*$  คือความจุไฟฟ้าเชิงช้อนกรณีมีวัสดุไดอิเล็กทริก และ  $C_0$  คือความจุไฟฟ้ากรณีมีสุญญากาศระหว่าง อิเล็กโทรด (โดยที่ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดคือความหนาของสารตัวอย่าง,  $d_s$ ) เมื่อแทนสมการ (3.39) ใน สมการ (3.44) จะได้

$$I^* = \omega C_0 (\varepsilon'' + j\varepsilon') V \quad (3.45)$$



ภาพที่ 3.5 แผนภาพวงจรไฟฟ้าของการวัดสมบัติทางไดอิเล็กทริก (ประสิทธิ์ ทองใบ, 2549)

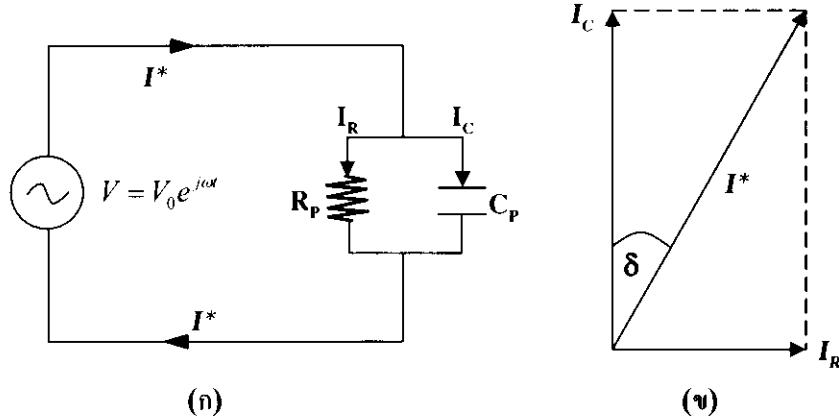
วัสดุตัวอย่างไดอิเล็กทริกในวงจรสามารถพิจารณาว่าเป็นวงจรไฟฟ้าแบบขาน (ภาพที่ 3.6) และค่าแอดมิตtanซ์ (admittance,  $Y^*$ ) หรือส่วนกลับของค่าอิมพีเดนซ์ (impedance,  $Z^*$ ) ของวงจร ดังกล่าวสามารถแสดงได้ดังสมการ

$$Y^* = \frac{1}{R_p} + j\omega C_p \quad (3.46)$$

เมื่อ  $R_p$  และ  $C_p$  คือความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กทริกและความจุไฟฟ้าเทียบเคียงที่ต่อ กันแบบขาน ตามลำดับ ดังนั้น กระแส  $I^*$  ที่ผ่านวงจรสามารถแสดงได้เป็น

$$I^* = VY^* = \left( \frac{1}{R_p} + j\omega C_p \right) V = I_R + jI_C \quad (3.47)$$

เมื่อ  $I_R$  และ  $I_C$  คือส่วนจริงและส่วนจินตภาพของกระแสเชิงช้อน  $I^*$  ตามลำดับ



ภาพที่ 3.6 (ก) วงจรไฟฟ้าแบบขนานของตัวเก็บประจุที่มีสารไดอิเล็กทริก (ข) เพสเซอร์ของกระแสในวงจร  
(เมื่อ  $R_p$  และ  $C_p$  คือความต้านทานและความจุไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กทริกที่ต่อกันแบบขนาน  
ตามลำดับ) (ประวัติที่ ทองใบ, 2549)

จากสมการที่ (3.45) และ (3.47)  $\varepsilon'$  และ  $\varepsilon''$  สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\varepsilon' = \frac{I_C}{\omega C_o V} = \frac{C_p}{C_o} \quad (3.48)$$

$$\varepsilon'' = \frac{I_R}{\omega C_o V} = \frac{1}{\omega C_o R_p} \quad (3.49)$$

ดังนั้น

$$\tan \delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} = \frac{I_R}{I_C} \quad (3.50)$$

สมการที่ (3.49) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น

$$\varepsilon'' = \frac{1}{\omega C_o R_p} = \frac{G_p}{\omega C_o} \quad (3.51)$$

เมื่อ  $G_p = 1/R_p$  คือความนำไฟฟ้ากระแสลับ (AC conductance) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคือผลรวมส่วนนำไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง (ตั้ง เช่น การเคลื่อนที่ของประจุ) และความนำไฟฟ้าที่เกิดจากกระบวนการโพลาไรเซชันที่ขึ้นกับเวลา (เช่น การเคลื่อนที่ของไดโอลไฟฟ้า)

ถ้าแผ่นอิเล็กโทรดมีพื้นที่  $A$  แยกห่างกันเป็นระยะทาง  $d_s$  (ความหนาของสารตัวอย่าง)  
ดังนั้น  $G_p$  และ  $C_o$  สามารถเขียนได้เป็น

$$G_p = \frac{\sigma A}{d_s} \quad (3.52)$$

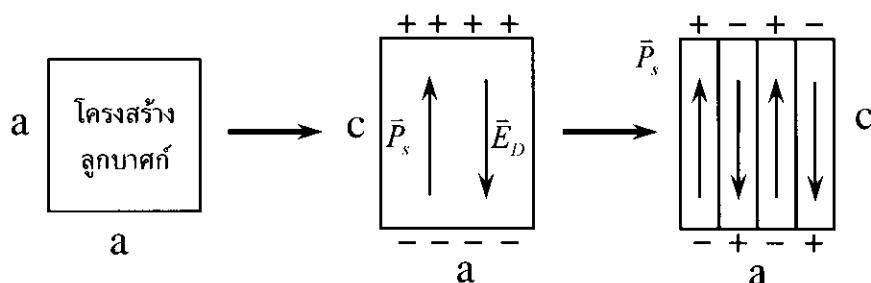
$$C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d_s} \quad (3.53)$$

ดังนั้น  $\epsilon'' = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \omega}$  (3.54)

เมื่อ  $\sigma$  คือส่วนนำไฟฟ้า (conductivity) ของสารไดอิเล็กทริก

### 3.2 โดเมนเฟอร์โรอิเล็กทริก (รัตติกร ยั่มนิรัญ, 2549) และ (Kao, 2004)

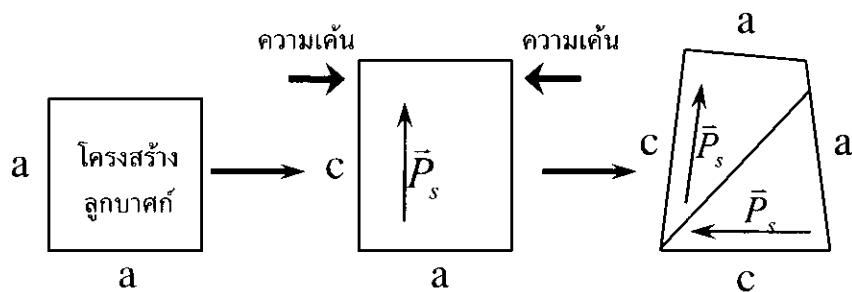
วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริก (ferroelectric material) เป็นวัสดุที่มีผลึกประเกทไม่มีศูนย์กลางของสมมาตร (non-centrosymmetry) ลักษณะของผลึกประเกทไม่มีศูนย์กลางของสมมาตรนี้จะเกิดโพลาไรเซชัน ได้เองโดยไม่มีสาเหตุจากไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง (spontaneous polarization,  $\bar{P}_s$ ) ในลักษณะที่ได้พลอยเม่นต์การเรียงตัวในทิศทางเดียวกันเป็นหย่อม ๆ ซึ่งได้พลอยเม่นต์การที่เรียงตัวในทิศทางเดียวกันเรียกว่าโดเมน (domain) ดังนั้นในผลึกจะมีโดเมนไฟฟ้าอยู่มากน้อย และขอบของแต่ละโดเมนจะเรียกว่า ผนังโดเมน (domain wall) โดเมนเฟอร์โรอิเล็กทริกเกิดขึ้นเพื่อลดระดับพลังงานศักยไฟฟ้าสถิตของสนามทำให้หมดสภาพการมีข้าว (depolarizing) และทำให้พลังงานยึดหยุ่นที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดทางกลที่เกิดขึ้นกับโดเมนเฟอร์โรอิเล็กทริกในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากพาราอิเล็กตริกไปสู่เฟอร์โรอิเล็กทริกให้มีค่าต่ำที่สุด การเกิดขึ้นของสภาพการมีข้าวที่อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะจากพาราอิเล็กตริกไปสู่เฟอร์โรอิเล็กทริกจะทำให้เกิดประจุที่บริเวณพื้นผิวซึ่งทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่เรียกว่า สนามที่ทำให้หมดสภาพการมีข้าว (depolarizing field,  $\bar{E}_D$ ) ที่มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางของโพลาไรเซชัน ซึ่งสนามที่ทำให้หมดสภาพการมีข้าวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระจายตัวที่ไม่สม่ำเสมอของโพลาไรเซชัน หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนทิศทางของสภาพการมีข้าวที่บริเวณรอยต่อของขอบเกรน (grain boundaries) พลังงานไฟฟ้าสถิต (electrostatic energy) ที่เกี่ยวข้องกับสนามที่ทำให้หมดสภาพการมีข้าวอาจทำให้ลดลงต่ำสุดได้โดยทำให้วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกดังกล่าวแยกออกไปเป็นหลาย ๆ โดเมนโดยมีทิศทางการจัดเรียงตัวของทิศทางสภาพการมีข้าวในลักษณะตรงข้ามกัน ดังภาพที่ 3.7



การเกิดผนังโดเมน 180°

ภาพที่ 3.7 การเกิดผนังโดเมน 180° ในวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกเพอร์อฟส์ไกค์ที่มีโครงสร้างแบบเทแทร์โกลนัล (รัตติกร ยั่มนิรัญ, 2549)

การแยกตัวของเฟอร์โรอิเล็กทริกทำให้เกิดโดยเมนขึ้น เช่นกันระหว่างที่เกิดการเย็บตัวผ่านอุณหภูมิคู่รี ดังนั้นเพื่อที่จะลดพลังงานยึดหยุ่นให้ต่ำสุดแกน c ของโครงสร้างแบบเทหะรอนิกอล (แกนที่ยาวกว่า) จะเกิดขึ้นในทิศทางที่ตั้งฉากกับความเค้น ในขณะที่ส่วนของผลึกที่ไม่อยู่ภายใต้ความเค้นสภาพการมีข้าวจ้าจะจัดเรียงตัวในทิศทางที่ขนานกับทิศทางของความเค้น (แกน a ของโครงสร้างแบบเทหะรอนิกอล) ดังภาพที่ 3.8 ดังนั้นผนังโดยเมนในวัสดุอาจจะแยกบริเวณที่ทิศทางการมีสภาพข้าวจัดเรียงในทิศทางที่ขนานกับหรือที่เรียกว่าผนังโดยเมน  $180^\circ$  หรือบริเวณที่ทิศทางการมีสภาพข้าวจัดเรียงในทิศตั้งฉากกับหรือที่เรียกว่าผนังโดยเมน  $90^\circ$  ถึงแม้ว่าผนังโดยเมน  $90^\circ$  และ ผนังโดยเมน  $180^\circ$  อาจจะลดสนานที่ทำให้หมดสภาพการมีข้าวจัดได้ แต่มีเพียงการเกิดผนังโดยเมน  $90^\circ$  เท่านั้นที่ทำให้พลังงานศักย์ยึดหยุ่นมีค่าต่ำที่สุด



การเกิดผนังโดยเมน  $90^\circ$

ภาพที่ 3.8 การเกิดผนังโดยเมน  $90^\circ$  ในวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกเพอร์อฟส์ไกท์ที่มีโครงสร้างแบบเทหะรอนิกอล (รัตติกร ยั่มนิรัญ, 2549)

สำหรับในกรณี  $\text{BaTiO}_3$  ภายในโดยเมนมีทิศทางของไดโพลมากกว่า 2 ทิศทาง เช่น เมื่อพิจารณาโครงสร้างแบบเทหะรอนิกอลของ  $\text{BaTiO}_3$  ทิศทางของโพลาไรเซชันจะเกิดขึ้นตามแกน c ( $c$ -axis) ซึ่งเกิดจากการยึดออกของแกนในโครงสร้างแบบลูกบาศก์ a ( $a$ -axis) แต่ภายในโดยเมนของวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกมีทิศทางของไดโพล 6 ทิศทางในการขับขึ้นของแกน c ซึ่งสามารถเป็นทิศทาง  $\pm x$ ,  $\pm y$  และ  $\pm z$  ซึ่งเป็นทิศทาง 3 คู่ที่ไม่ขนานกันตามขอบของโครงสร้างแบบลูกบาศก์ โดยเมนของเฟอร์โรอิเล็กทริกสามารถมีทิศทางของไดโพล ได้ 6 ทิศทางในการโพลาไรเซชันโดยการแบ่งไดโพลที่ไม่ขนานกันด้วยผนังโดยเมน  $180^\circ$  และ โดยเมน  $90^\circ$  แต่สำหรับในโครงสร้างแบบรอมโบเสอร์ลอมมีทิศทางของไดโพลการเกิดโพลาไรเซชัน 8 ทิศทาง และ มีโดยเมน  $70.5^\circ$  และ โดยเมน  $110^\circ$  ซึ่งรายละเอียดการเกิดโดยเมน  $180^\circ$  และ โดยเมน  $90^\circ$  จะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

### 3.2.1 โดยเมน $180^\circ$

โดยทั่วไปแล้วพลังงานความเครียด (strain energy) มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของภายในผนังโดยเมนของเฟอร์โรอิเล็กทริก ผนังโดยเมน  $180^\circ$  และ โดยเมน  $90^\circ$  มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน การเคลื่อนที่ของผนังโดยเมน  $180^\circ$  เกิดขึ้นภายใต้ผลของการให้สนานไฟฟ้าเข้าไป ซึ่งการเคลื่อนที่ของผนังโดยเมน  $180^\circ$  นั้น ไอออนบางจะเลื่อนมากขึ้นจึงทำให้ทิศทางของการโพลาไรเซชันมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ทำให้ได้โพลเกิดการหมุนหรือทำให้ผลึกเกิดการการเปลี่ยนรูปร่าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดยเมน  $180^\circ$  มีทิศทางการโพลาไรเซชันในทิศทางเดียวกับทิศทางของการให้สนานซึ่งทำให้ผนังของโดยเมนมีการขยายออกทางด้านข้างตามการเคลื่อนของผนังโดยเมน

### 3.2.2 โถเมน 90°

ผนังโถเมน 90° เป็นผนังโถเมนที่ยากต่อการทำให้เคลื่อนที่ ซึ่งในการทำให้ผนังโถเมน 90° เคลื่อนที่นั้นจำเป็นต้องให้สนาમไฟฟ้าที่มีค่าสูงมาก ดังนั้นการทำให้เกิดโถเมนด้วยโพลาไรเซชันที่มีทิศทางตั้งฉากกับสนาમที่ให้เข้าไปอาจเปลี่ยนทิศของการโพลาไรเซชันไปตามทิศของสนาມ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้โครงสร้างของผลึกมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเกิดโพลาไรเซชันอย่างสมบูรณ์ในทิศทางเดียวกับทิศทางการให้สนาມสำหรับเฟรโรอิเล็กทริกที่มีหลายแกน (multiaxial) มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากซึ่งจะกล่าวในกรณีจ่ายๆ เช่น สำหรับผลึกที่มีโถเมนเดียวและมีโพลาไรเซชันตามแกน c ในโครงสร้างแบบเทหะระgonal ถ้าให้สนาມไฟฟ้าในแกน a (ที่ตั้งฉากกับแกน c) โถเมนใหม่จำนวนมากถูกสร้างขึ้นที่ผิวและถูกโพลาไรซ์ในทิศทางของ การให้สนาມการเกิดเป็นโถเมนใหม่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผลึกทั้งหมดถูกโพลาไรซ์ในทิศทางของสนาມจนกระทั่งเกิดเป็นโถเมนใหม่ที่บริเวณผิวของผลึกของวัสดุ (บริเวณผิวที่เป็นอิเล็กโทรด) และเดิบโตในทิศเดียวกับทิศของสนาມที่มีการเคลื่อนที่ของผนังโถเมนด้านข้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตามการเกิดโถเมนใหม่เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากมีอันตรกิริยาของ electro-mechanical ของอนุภาคในหลายโถเมนของผลึก

### 3.3 ผลของขนาดเกรน (Moulson, Herbert, 2003)

เมื่อเกรนของผลึกเดียวของวัสดุเซรามิกเฟรโรอิเล็กทริกถูกลดอุณหภูมิลงและผ่านอุณหภูมิคริวี เกรนของวัสดุเซรามิกจะพยายามขยายตัวยืดออกไปในทิศทางแกน c และในขณะเดียวกันเกรนของวัสดุเซรามิกจะหดตัวลงในทิศแกน a (โดยที่ a และ c คือค่าแอลติชพารามิเตอร์ของโครงสร้างแบบเทหะระgonal) ส่งผลให้ความเด็นที่อยู่ภายใต้เกรนของวัสดุเซรามิกลดลงเนื่องจากผนังโถเมน 90° ซึ่งกลไกการลดลงของความเด็นนี้จะพบทั้งในเกรนขนาดใหญ่และเกรนขนาดเล็ก การลดลงของขนาดเกรนส่งผลให้ความกว้างของผนังโถเมน 90° มีค่าลดลงทำให้พื้นที่ของผนังโถเมนต่อหน่วยปริมาตรของวัสดุเซรามิกมีค่าเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิกเฟรโรอิเล็กทริกมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย การเพิ่มขึ้นของพลังงานความเครียดเชิงกล (mechanical strain energy) ภายในเกรนของวัสดุเซรามิกเป็นผลเนื่องจากโถเมนภายในเกรนถูกหักล้างโดยการเพิ่มขึ้นของพลังงานในผนังโถเมน ที่สภาวะสมดุลพลังงานรวมภายในจะมีค่าน้อยที่สุดโดยที่พลังงานความเครียด (strain energy,  $\varepsilon_s$ ) ต่อหน่วยปริมาตรถูกครอบครองโดยโถเมน 90° สามารถคำนวณได้จาก

$$\varepsilon_s = \frac{dYx^2}{128\pi g} \quad (3.55)$$

เมื่อ  $g$  คือ ขนาดเกรนเฉลี่ย  $d$  คือ ความกว้างของเกรน  $Y$  คือ ค่าโมดูลัสของยัง และ  $x = \frac{c}{a-1}$  ดังนั้น พลังงานของผนังโถเมน (domain wall energy,  $\varepsilon_d$ ) ต่อหน่วยปริมาตรเรียนได้เป็น

$$\varepsilon_d = \frac{\gamma}{d} \quad (3.56)$$

เมื่อ  $\gamma$  คือ พลังงานพื้นผิว (surface energy) ที่เกี่ยวข้องกับผนังโถเมน 90° ดังนั้นพลังงานรวม (total energy,  $\varepsilon_t$ ) คือ

$$\varepsilon_t = \varepsilon_s + \varepsilon_d \quad (3.57)$$

แทนค่าสมการที่ (3.55) และ สมการที่ (3.56) ในสมการที่ (3.57) จะได้ว่า

$$\varepsilon_t = \frac{dYx^2}{128\pi g} + \frac{\gamma}{d} \quad (3.58)$$

หากอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของสมการที่ (3.58) เทียบกับ  $d$  เมื่อ  $\frac{\partial \varepsilon_t}{\partial d} = 0$  ที่เงื่อนไขพลังงานรวมน้อยที่สุด จะได้

$$d = \left( \frac{128\pi\gamma g}{Yx^2} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3.59)$$

สำหรับ  $\text{BaTiO}_3$  ค่า  $\gamma \approx 3 \text{ mJm}^{-2}$ ,  $Y \approx 1.7 \times 10^{11} \text{ Pa}$  และ  $x \approx 10^{-12}$  ดังนั้น จากสมการที่ (3.56) จะได้ว่า

$$d \approx 2 \times 10^{-4} \text{ g}^{\frac{1}{2}} \quad (3.60)$$

จากสมการที่ (3.60) จะเห็นได้ว่าความกว้างของเกรนของวัสดุเซรามิก  $\text{BaTiO}_3$  มีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับรากที่สองของขนาดเกรนของวัสดุ นั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่อขนาดของเกรนลดลงจะส่งผลให้ความกว้างของผนังโดเมน  $90^\circ$  มีค่าลดลงด้วย จึงทำให้พื้นที่ของผนังโดเมนต่อหน่วยปริมาตรของวัสดุมีค่าเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก  $\text{BaTiO}_3$  มีค่าเพิ่มขึ้นด้วย

### 3.4 ผลของความเด็น (รัตติกร ยิ่มนิรัญ, 2549)

สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเฟรโรอิเล็กทริกที่เกิดจากผลของธรรมชาติภายในตัวของมันเอง (intrinsic contribution) ซึ่งเกิดจากการตอบสนองของโดเมนเดียว และผลจากภายนอก (extrinsic contribution) ซึ่งเกิดจากการขยับเคลื่อนย้ายของผนังโดเมน เมื่อวัสดุเฟรโรอิเล็กทริกได้รับความเด็นเชิงกลจากภายนอกความเด็นเชิงกลที่ให้เข้าไปนั้นจะทำให้โครงสร้างโดเมนมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้พลังงานภายในโดเมนมีค่าต่ำสุด ระหว่างเกิดกระบวนการนี้โดเมนบางโดเมนจะถูกรวบเข้ากับโดเมนอื่นหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไป ภายใต้ความเด็นแบบแกนเดียวโครงสร้างโดเมนของวัสดุเซรามิกเฟรโรอิเล็กทริกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของโดเมน (domain switching) การตรึงของผนังโดเมน การทำให้หมุดสภาพการเป็นช้า และการลดการเลื่อนสภาพตามอายุ เมื่อความเด็นถูกอัดเข้าไปในทิศทางขานานกับทิศของช้า ความเด็นที่ให้เข้าไปจะเคลื่อนย้ายบางโพลาไรเซชันจากทิศทางของช้า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของโดเมนซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพิ่มความหนาแน่นของผนังโดเมนในทิศทางที่ไม่ใช่  $180^\circ$  (non- $180^\circ$ ) ดังนั้นเมื่อให้ความเด็นเข้าไปจะทำให้ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกมีค่าสูงขึ้น ส่วนการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกนี้ การเพิ่มขึ้นของการเคลื่อนที่ของผนังโดเมนจะช่วยทำให้ค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกมีค่าเพิ่มขึ้นในบางองค์ประกอบ แต่ในขณะที่ลดการเลื่อนสภาพของตัววัสดุก็จะทำให้ค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกลดลงได้ในบางองค์ประกอบเช่นกัน